

Gasphasenzersetzung (VPD) + Induktiv gekoppelte Plasma Massen Spektrometrie (ICP-MS)



Leibniz Institute
for high
performance
microelectronics

Technische Parameter

WSPS2 - VPD automation system:

- Offene Kassettenstation
- **Robotersystem:** vollautomatisches Waferhandling und Prozessierung
- **PAD-Fume:** Ätzung der Oberfläche oder Bulk-Ätzung von Si
- **PAD-Scan:** Abscannen der Oberfläche mit einem Flüssigkeitstropfen
- **Scanoptionen:** Bevel Scan (für Wafertrand) and hydrophiler Scan

Element2:

- **Großes Spektrum an Elementen:** >33
- **Detektionslimit:** $1 \cdot 10^8$ at/cm²
- **Hoher dyn. Bereich:** $>1 \cdot 10^9$ cps
- **Hoher Linearitätsbereich:**
 $1 \cdot 10^8$ at/cm² - $1 \cdot 10^{12}$ at/cm²
- **Hohe Massenaufösung (HR):**
MRP>10000



Einsatzgebiete

- Abwasseruntersuchungen
- Reinheitsbestimmung von Chemikalien, UPW und DI Wasser
- CVD-Tools für TEOS-Oxide, SiN and SiON zur Schichtreinheitsbestimmung
- Implanter zur Bestimmung der Ausgangskontamination (Ar-Implantation in dünnen Oxiden)
- Messtechnik-Tool (blanker Si-Wafer)
- Reinheitsuntersuchung des Reinraums mittels Monitor-Wafer (blanke Wafer)

Ansprechpartner:

Dr. Ioan Costina

Telefon: +49 335 5625 370

Fax: +49 335 5625 327

Email: costina@ihp-microelectronics.com